

# 分光エリプソメーター

新製品



SpecEL-2000

高精度・高再現性・  
操作性を重視

余分な機能を外した  
コンパクト・低価格モデル

SpecEL-2000は1 nm～10 μmの膜厚が測定できる、白色光を光源とした分光エリプソメーターです。

単層膜・多層膜の光学定数(屈折率n、吸収係数k)、膜厚の測定が可能です。本装置の光源、検出器とも角度が固定されているので、調整不要で簡単に薄膜の測定ができます。

## 特長

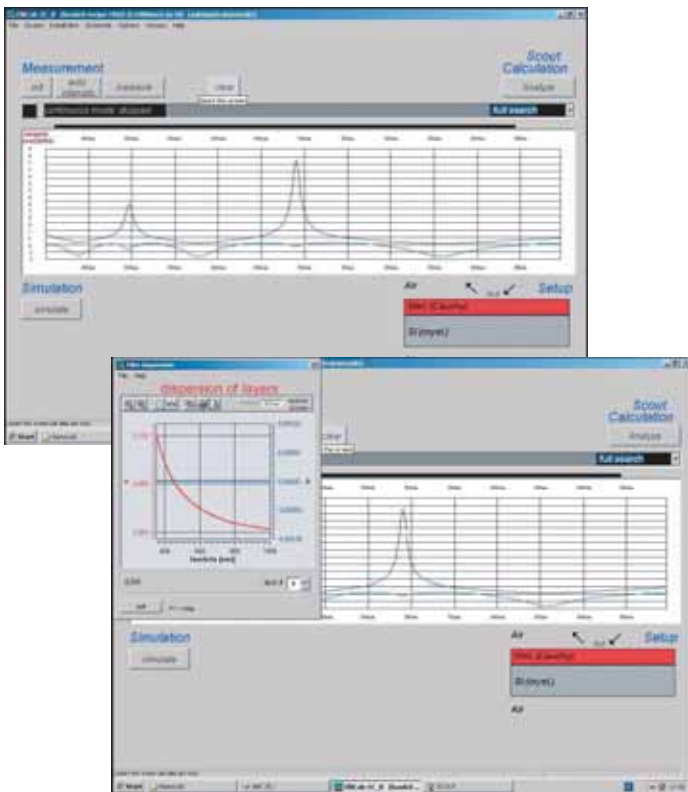
- 調整不要、簡単操作(レシピ付)
- 光学定数測定(屈折率n、吸収係数k)、膜厚測定
- 数多くの異なる解析分散モデル、あらゆる試料に対応
- オプション:全自動マッピングステージ(300mm XYステージ)

## 仕様

- 分光波長範囲: 300 nm～1000 nm (UV/VIS/NIR)  
450 nm～1000 nm (VIS/NIR)
- 膜層数: 最大10層
- 膜厚範囲: 1 nm～10 μm
- 再現性精度:  $\cos(\Delta) = \pm 0.0003$   
 $\tan(\psi) = \pm 0.0002$   
(Si基板上的SiO<sub>2</sub>70 nm厚さの場合)
- 測定時間: 7～13秒/点
- 入射角度: 70° (他入射角度可)
- 波長分解能: 1 nm
- スポットサイズ: 400×1200 μm
- 高さ・角度調節: ±1.0mm、±1° (サンプル調整用)
- インターフェース: USBおよびRS-232

## 主な用途

- 半導体分野(酸化膜、窒化膜、フォトレジスト、アモルファス、結晶半導体、化合物半導体 等)
- FPD分野(LCD、TFT、OLED、PDP)
- 光学コーティング分野(フィルタ、カラーフィルタ、反射防止膜、ハードコート)
- その他、金属、プラスチックなど



メインインターフェース画面  
膜厚およびn、kの測定結果を表示